

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第1区分

【発行日】平成23年8月11日(2011.8.11)

【公表番号】特表2010-534607(P2010-534607A)

【公表日】平成22年11月11日(2010.11.11)

【年通号数】公開・登録公報2010-045

【出願番号】特願2010-517299(P2010-517299)

【国際特許分類】

C 04 B 7/345 (2006.01)

【F I】

C 04 B 7/345

【手続補正書】

【提出日】平成23年6月24日(2011.6.24)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項1】

Q<sup>1.5</sup>以下の平均架橋度とシラノール基とを有するシリケート構造単位を含む配置でケイ素原子、カルシウム原子、酸素原子及び水素原子を含有する単相水硬性結合材であって、カルシウム原子が、酸素が6重以上に配位する金属原子M[6]<sup>x+</sup>で、その一部が置換されているか若しくは一切そのようには置換されておらず、又はケイ素原子が、酸素が四面体的に配位する金属原子M[4]<sup>y+</sup>で、一部が置換されているか若しくは一切そのようには置換されておらず、[CaO+(x/2)·(M[6]<sup>x+</sup>O<sub>x/2</sub>)]:[SiO<sub>2</sub>+M[4]<sup>y+</sup>O<sub>y/2</sub>]モル比が0.75~2.75の値を有し、そして結合材が3.5重量%~20重量%のH<sub>2</sub>Oを含有する単相水硬性結合材。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0030

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0030】

この目的は、単相水硬性結合材に関しては、請求項1に記載の発明(Q<sup>1.5</sup>以下の平均架橋度とシラノール基とを有するシリケート構造単位を含む配置でケイ素原子、カルシウム原子、酸素原子及び水素原子を含有する単相水硬性結合材であって、カルシウム原子が、酸素が6重以上に配位する金属原子M[6]<sup>x+</sup>で、その一部が置換されているか若しくは一切そのようには置換されておらず、及び/又はケイ素原子が、酸素が四面体的に配位する金属原子M[4]<sup>y+</sup>で、一部が置換されているか若しくは一切そのようには置換されておらず、[CaO+(x/2)·(M[6]<sup>x+</sup>O<sub>x/2</sub>)]:[SiO<sub>2</sub>+M[4]<sup>y+</sup>O<sub>y/2</sub>]モル比が0.75~2.75の値を有し、そして結合材が3.5重量%~20重量%のH<sub>2</sub>Oを含有する単相水硬性結合材)によって、混合物に関しては、請求項6に記載の発明(上記本発明の単相水硬性結合材を含有する混合物)によって、製造方法に関しては、請求項8又は9のいずれか一項に記載の発明((a)ケイ素原子、カルシウム原子、酸素原子及び水素原子を含有する固体出発材料の混合物を準備し、この混合物を、シラノール基を含有するヒドロキソケイ酸カルシウムへ変換する工程と、(b)このヒドロキソケイ酸カルシウムを、単相水硬性結合材が形成されるまで、粉碎する工程と、(c)この単相水硬性結合材を、H<sub>2</sub>O含有率が20重量%を超える場合、3.5重量%~20重量%

の  $H_2O$  含有率になるまで乾燥させる工程と、を含む、上記本発明の単相水硬性結合材の製造方法、又は、( a' ) ケイ素原子、カルシウム原子、酸素原子及び水素原子を含有する、シリケート含有原材料とカルシウム含有原材料との、混合物を準備し、この混合物を、シラノール基を含有するヒドロキソケイ酸カルシウムをある程度含有するプレ生成物へ、変換する工程と、( b' ) このプレ生成物を、ヒドロキソケイ酸カルシウムから単相水硬性結合材が形成されるまで粉碎する工程と、( c' ) この形成された単相水硬性結合材を含有する混合物を、単相水硬性結合材の  $H_2O$  含有率が 20 重量 % を超える場合、3.5 重量 % ~ 20 重量 % の  $H_2O$  含有率へ乾燥させる工程と、を含む、上記翻発明の混合物の製造方法) によって、そして、建材に関しては、請求項 14 に記載の発明(上記本発明の単相水硬性結合材又は上記本発明の混合物の水による固化と、その後の硬化によって製造される建材) によって達成される。上記各請求項に従属する下位クレームはそれぞれ、本発明の有利な実施形態を記載する。